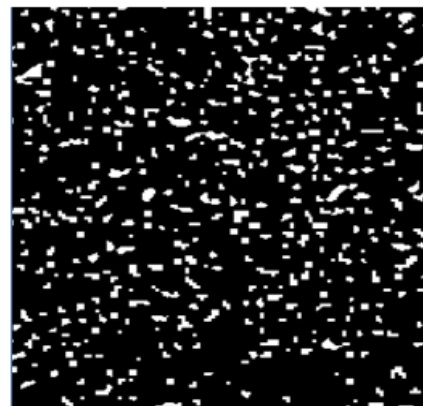


ポリイミド-シリカ複合体エナメル線の作製

ポリアミド酸のNMPワニス中でテトラエトキシシランと水をゾル-ゲル反応させて形成したシリカを含むワニスを銅線の上にコートした後、 260°C ~ 360°C で熱処理して作製したポリイミド-シリカ複合体の絶縁電線はシリカの粒径が $0.1\ \mu\text{m}$ と均一に分散したため、 400°C の熱にさらしても絶縁特性の低下をほとんど示さなかった。



1 μm

キーワード

ゾル-ゲル法、ポリイミド-シリカ複合体、エナメル線

分野

有機化学、高分子化学、高分子物性